

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 3 月 9 日 (2006.3.9)

【公開番号】特開 2005-285776 (P2005-285776A)

【公開日】平成 17 年 10 月 13 日 (2005.10.13)

【年通号数】公開・登録公報 2005-040

【出願番号】特願 2005-107007 (P2005-107007)

【国際特許分類】

H 0 1 J 37/28 (2006.01)

H 0 1 J 37/20 (2006.01)

H 0 1 J 37/30 (2006.01)

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

G 0 1 N 23/225 (2006.01)

【F I】

H 0 1 J 37/28 B

H 0 1 J 37/20 A

H 0 1 J 37/30 Z

H 0 1 J 37/317 D

G 0 1 N 23/225

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 1 月 20 日 (2006.1.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

試料室内における微小試料加工観察方法であって、
 試料台に載置された試料に、イオンビームを照射して微小試料を摘出し、
 第 2 試料台に微小試料を固定し、
 第 2 試料台に固定されている微小試料にイオンビームを照射し、微小試料を加工し、
 第 2 試料台に固定された微小試料が、電子ビームに対して所定の角度となるよう、第 2 試料台の角度を変更し、
 第 2 試料台に固定されている微小試料に電子ビームを照射し、微小試料を測定する方法。